

Title (en)

METHOD AND INSTALLATION FOR ELIMINATING IMPURITIES FROM A GAS STREAM CONTAINING SOLVANT VAPORS.

Title (de)

VERFAHREN UND ANLAGE ZUR ENTFERNUNG VON VERUNREINIGUNGEN AUS EINEM LÖSUNGSMITTELDÄMPFE ENTHALTENDEN GASSTROM.

Title (fr)

PROCEDE ET INSTALLATION POUR ELIMINER LES IMPURETES D'UN COURANT DE GAZ CONTENANT DES VAPEURS DE SOLVANT.

Publication

EP 0085086 A1 19830810 (DE)

Application

EP 82902449 A 19820813

Priority

DE 3132292 A 19810814

Abstract (en)

[origin: WO8300641A1] Solid and liquid impurities, particularly at a high boiling point, are evacuated from a gas stream containing solvent vapors by washing the gas stream with the condensate of one or a plurality of solvent vapors that it contains, preferably with the fraction having the highest affinity with the impurities to be eliminated. The solvent, respectively the mixture of solvents, used for the washing is reintroduced appropriately in the process after its separation by distillation from the impurities, preferably after its extraction from the gas stream by condensation and/or adsorption. The gas stream may be directed towards an evaporation chamber wherein it is again laden with solvent vapors.

Abstract (fr)

Les impuretés solides et liquides, en particulier à point d'ébullition élevé, sont évacuées d'un courant de gaz contenant des vapeurs de solvant en lavant le courant de gaz avec le condensat d'une ou plusieurs vapeurs de solvant qu'il contient, de préférence avec la fraction qui présente la plus grande affinité avec les impuretés à éliminer. Le solvant, resp. le mélange de solvants, utilisé pour le lavage est réintroduit de manière appropriée dans le processus après sa séparation des impuretés par distillation, de préférence après son extraction du courant de gaz par condensation et/ou adsorption. Le courant de gaz peut être dirigé vers une chambre d'évaporation où il est chargé de nouveau de vapeurs de solvant.

IPC 1-7

B05C 15/00; **B05D 1/02**; **B01D 50/00**

IPC 8 full level

B01D 5/00 (2006.01); **B01D 50/00** (2006.01); **B01D 53/14** (2006.01); **B01D 53/44** (2006.01); **B01D 53/74** (2006.01); **B01D 53/81** (2006.01); **B05B 14/49** (2018.01); **B05B 15/12** (2006.01); **B05C 15/00** (2006.01); **B05D 1/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B01D 53/14 (2013.01 - EP US); **B05B 14/49** (2018.01 - EP US); **Y02P 70/10** (2015.11 - EP)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

DE 3132292 A1 19830303; **DE 3132292 C2 19860507**; AU 560085 B2 19870326; AU 8820182 A 19830308; DE 3265848 D1 19851003; DK 160192 B 19910211; DK 160192 C 19910715; DK 161883 A 19830413; DK 161883 D0 19830413; EP 0085086 A1 19830810; EP 0085086 B1 19850828; ES 514968 A0 19830916; ES 8308490 A1 19830916; FI 76500 B 19880729; FI 76500 C 19881110; FI 831034 A0 19830325; FI 831034 L 19830325; JP S58501269 A 19830804; US 4494967 A 19850122; WO 8300641 A1 19830303

DOCDB simple family (application)

DE 3132292 A 19810814; AU 8820182 A 19820813; DE 3265848 T 19820813; DK 161883 A 19830413; EP 8200171 W 19820813; EP 82902449 A 19820813; ES 514968 A 19820813; FI 831034 A 19830325; JP 50246982 A 19820813; US 50201883 A 19830414